18p-E10-11

## 電子線ホログラフィーによる InGaZnO<sub>4</sub>/SiO<sub>2</sub>界面の電荷分布の直接観察 In-situ electron holography of carrier accumulation at InGaZnO<sub>4</sub>/SiO<sub>2</sub> interface ルネサスエレ、<sup>o</sup>五十嵐信行、西藤哲史、竹田裕、井上尚也、砂村潤、竹内潔、羽根正已 <sup>o</sup>N. Ikarashi, M. Saitoh, H. Takeda, N. Inoue, H. Sunamura, K. Takeuchi, and M. Hane

**Renesas Electronics Corp., E-mail:** <u>nobuyuki.ikarashi.xz@renesas.com</u> [はじめに] InGaZnO<sub>4</sub>等の酸化物半導体を用いた 方、Vpが±10Vの観察像では、In

デバイスが注目されている[1,2]。酸化物半導体/ 絶縁膜界面の電子状態はデバイス特性を決定す る物性の一つであるが、界面電子状態の直接的 物理分析の報告は殆ど無い。

本講演では InGaZnO<sub>4</sub>/SiO<sub>2</sub> 界面での電荷の蓄 積・空乏の定量的直接観察について報告する。 [実験] Si 基板上に InGaZnO<sub>4</sub> 薄膜をスパッタによ って形成し、その表面に SiO<sub>2</sub> を堆積した。ここか ら TEM 観察用の断面試料を作製した。試料に電 圧を印加するための探針を備えた TEM 試料ホル ダー用いた。図 1(a)は、ホログラフィー観察時の 試料と探針の模式図である。試料表面に、探針を 接触させ、電圧 Vp を印加した[3]。

電子線ホログラフィーでは、試料中のポテンシャル分布 V(x)の直接観察が可能である[3]。電荷分布を $\rho(x)$ 、誘電率を $\varepsilon$ とすると、ポアソン方程式  $\partial^2 / \partial x^2 V(x) = -\rho(x) / \varepsilon$ 

から、試料中の電荷分布の計測が可能である。 [結果と考察]図1(b)-(d)は、探針電圧 Vpが0,±10 Vの時のポテンシャル分布の観察例である。Vp= 0Vの場合(図1(c))、InGaZnO4 膜の観察像にポ テンシャルの等高線は観測されず、InGaZnO4 層 にポテンシャルの勾配が無い事を示している。一 方、Vpが±10Vの観察像では、InGaZnO4層には Vpに起因するポテンシャル勾配が観察される。

図 2(a)は、図 1(b)の破線に沿った電荷密度の 実測値である。電荷密度は、破線に沿ったポテン シャル分布を式(1)を用いて導出した。横軸の零 点は InGaZnO<sub>4</sub>と SiO<sub>2</sub>の界面に設定した。Vp>0 の場合には、InGaZnO4 表面に負電荷の蓄積が 観察され、Vp の増加と共に、電荷密度が増加し た。Vp<0の場合には、電荷の蓄積は観察されな かった。図 2(b)は、InGaZnO4 層のドナー密度を 1×10<sup>+16</sup> cm<sup>-3</sup> と仮定して計算した InGaZnO<sub>4</sub>/SiO<sub>2</sub> 界面の電荷の深さ方向分布の計算結果であり、 計算結果は、実測値を良く再現している。以上の 結果から、本実験で用いた InGaZnO4のドナー密 度を約 1×10<sup>+16</sup> cm<sup>-3</sup>と推定する事が可能である。 [結論]電子線ホログラフィーを用い InGaZnO4/絶 縁膜界面における電荷の蓄積や空乏の実測に ついて報告した。本計測手法は界面電荷密度の 定量計測が可能であり、InGaZnO4 の物性解析・ デバイス開発加速に応用可能である。

[参照文献] [1] K. Nomura et al., Nature 488, 432 (2004). [2] H. Sunamura et al. VLSI Symp. 2013 T250, [3] N. Ikarashi et al., Appl. Phys. Lett. 100, 143508 (2012).



Fig. 1 (a) An electrode probe was brought into contact with the cross-sectional specimen during holography. (b) - (d) Potential contour maps for Vp =  $0.0, \pm 10.0$  V.



Fig. 2 (a) Measured Vp-induced charge distribution. Negative charges build up at the  $InGaZnO_4/SiO_2$  interface when Vp is positive, while no charge accumulation is observed when Vp is negative. (b) Calculated Vp-induced charge distribution.